

ILSML®胶用光学透明抗静电剂

ILSML®专注国产化高端光学透明抗静电剂研发、生产，以不改变透明性和较低添加量为开发目标，使胶层及其组件改性达到长效至半永久透明防静电，通过机理研究结合实验验证的开发模式持续不断推出新品与解决方案，以追求满足光学透明 UV、热固、无卤、低撕膜电压等定向要求。

更新中...

型号	类型	添加量 %wt	方阻 ^a Log10(Ω/sq)	底涂 ^b	外观	水溶性	相容性 与弱极性	适用成型工艺 ^c		
								热干	UV	热固 ^d
IL1100 / II1105	含氟	0.5~1.5	9 / 8~9		白色粉末	溶	好	√		×
AI4300 / AI4400	含氟	0.5~2.5	9 / 8~9		透明液体/结晶固体	不溶	一般	√		×
FIP-15	含氟	0.5~2.5	9~10		透明液体/结晶固体	不溶	好	√		×
II2110 / II2120	含氟	0.5~2.5	9 / 8~9	↓ 1~3	透明液体	不溶	一般	√	√	×
II210A	含氟	0.5~2.5	8	↓ 1~3	透明液体	不溶	一般	√	√	×
FIP-20	含氟	0.5~2.5	9~10		透明液体/结晶固体	不溶	好	√		×
IC4404	无氟	0.5~2.5	8	↓ 1~3	透明液体	溶	一般	√	√	
NH3300	无卤	1~3	9~10	↓ 1~3	透明液体	溶	一般	√	√	
NH5500	无氟	1~3	9~10	↓ 1~3	透明液体	溶	一般	√	√	

注:a. 推荐添加量下可达到的方阻，方阻的降低随添加量增加会出现拐点，之后增加添加量，方阻并不显著降低，过多添加量反而易导致析出。

b. 结合高浓度抗静电剂底涂工艺可进一步降低方阻，提升抗静电效果。

c. 未打“×/√”表示未测或部分体系适用。

d. 特指含“异氰酸酯”体系。



021-38228895

技术咨询

www.ilschem.cn | 上海·默尼



业务咨询

www.moiear.cn | 上海·默逸

www.phiniee.cn | 上海·费尼